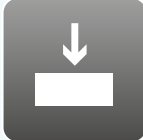




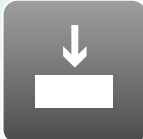










# Aka-Brief #21 喷涂陶瓷涂层零件

1	 Piatto 220+	 水	 300 RPM	 30 N	 磨平	 BF, 100x
2	 Allegran 3	 DiaUltra 6 μm	 150 RPM	 35 N	 4 min	 BF, 100x
3	 Silk	 DiaUltra 3 μm	 150 RPM	 30 N	 3 min	 BF, 100x
4	 Chemal*	 Colloidal Silica 50 nm Alkaline	 150 RPM	 15 N	 5 min**	 BF, 100x

图中所示时间与压力均适用于标准的300毫米制样系统和40毫米直径样品。

使用250毫米制样系统时，时间相应增加30%；使用200毫米制样系统时，时间相应增加 100%。

所使用的压力应随样品尺寸的增大和减小而进行相应的增大和减小。

样品夹/样品移动盘的转速为150转/分钟。

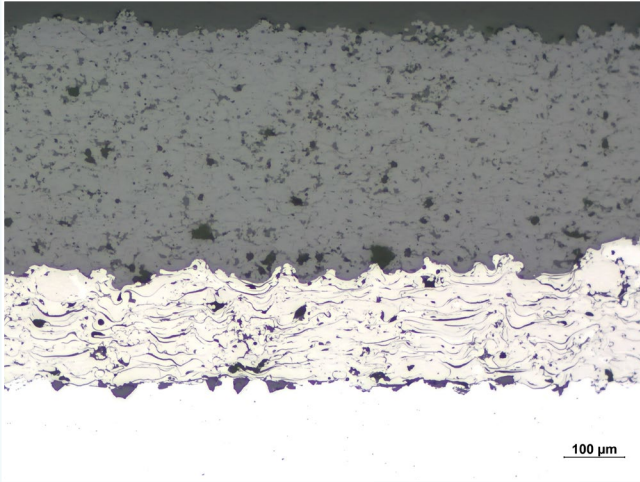
样品制备所需的时间和压力可能根据制样设备的不同而有所变化。

\*开始氧化抛光之前，加水使整片抛光布湿透，样品夹/样品移动盘下移接触到抛光布时，停止加水。在氧化抛光的最后10秒，加水冲洗样品和抛光布。

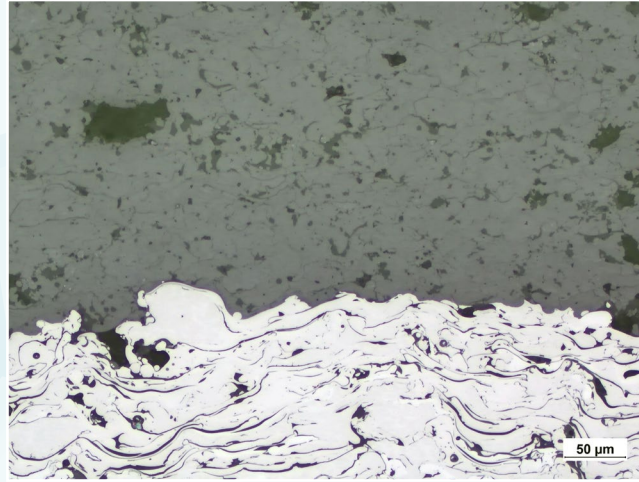
\*\* 对于其他陶瓷热喷涂涂层零件，可能需要增加氧化物抛光的时间。

# Aka-Brief #21 喷涂陶瓷涂层零件

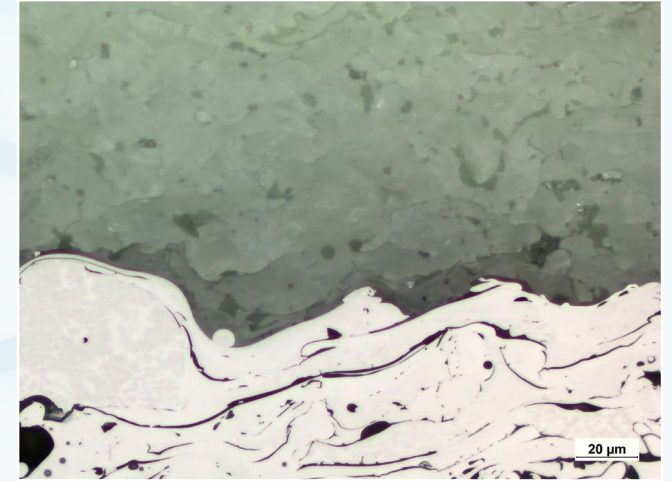
## 最终制样结果



陶瓷顶层和金属键合的热障涂层，明场像，100倍



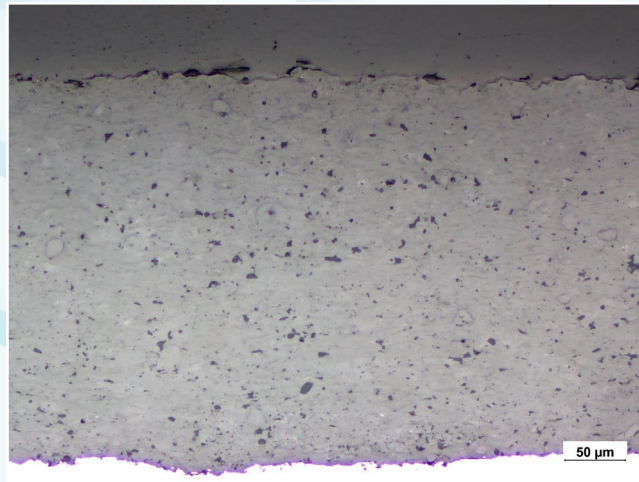
陶瓷顶层和金属键合的热障涂层，明场像，200倍



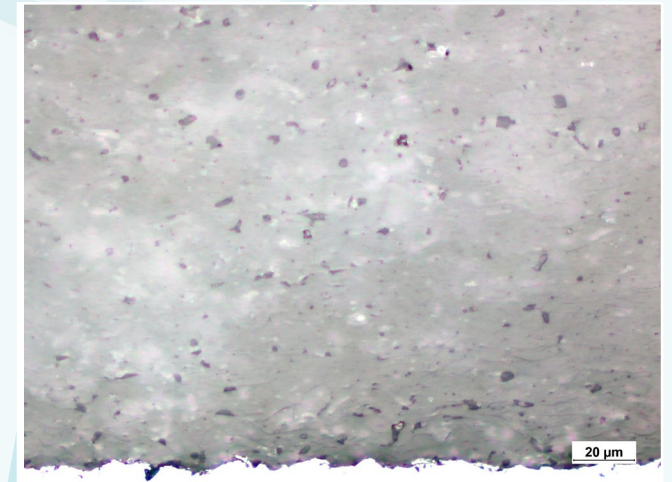
陶瓷顶层和金属键合的热障涂层，明场像，500倍



Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 钢基底上的铝涂层，明场像，100倍



Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 钢基底上的铝涂层，明场像，200倍



Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 钢基底上的铝涂层，明场像，500倍